

酸化膜CMP用 研磨スラリー

ILD™

酸化膜工程用ヒュームドシリカスラリー

ILD™ シリーズ

□ 特 長

- 砥粒の安定性向上（低スクラッチ性能）
- 高い機械研磨特性
- 希釈タイプ
- 高純度
- KOH/アンモニアベース



□ 物 性

| | ILD3013 | ILD3225 |
|------------|---------|---------|
| ケミカル | アンモニア | KOH |
| 砥粒濃度 (wt%) | 13.7 | 25.7 |
| pH | 10.5 | 11.0 |
| 粒子径 (nm) | 85 | 85 |
| 粘度 (cP) | 1.8 | 3.7 |
| 比重 | 1.08 | 1.17 |
| 希釈 | 原液使用タイプ | 2倍希釈タイプ |

※ ILD™はニッタ・デュポン(株)の商標です。

※ 記載されている物性値等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保証するものではありません。